

儀器設備介紹

設備名稱	氧電漿蝕刻系統
設備廠商/型號	世欣科技公司, SSI-T902

規 格

RF 射頻電漿匹配器(100 W-500 W)、機械幫浦一部、4 英吋高溫基板加熱模組(75 °C-300 °C)。

功 能

利用氣體電漿源對試片進行乾式蝕刻，可調控瓦數為(100 W-500 W)，其可用電漿氣體源為氫氣、氧氣及四氟化碳。

圖 片

